

488696-2026 - Състезателна процедура

Ирландия – Лабораторно, оптично и прецизно оборудване (без стъклени изделия) –
LA3215C-UCC-CFT for the Supply of a Suite of Plasma Etcher and Plasma Deposition Tools, 4
Lots

OJ S 134/2026 15/07/2026

Обявление за поръчка или концесия – стандартен режим - Обявление за промяна
Доставки

1. Купувач

1.1. Купувач

Официално наименование: Education Procurement Service (EPS)

Електронна поща: info@educationprocurementservice.ie

Правна категория на купувача: Публичноправна организация

Дейност на възлагащия орган: Услуги по общофункционално управление на държавата

2. Процедура

2.1. Процедура

Заглавие: LA3215C-UCC-CFT for the Supply of a Suite of Plasma Etcher and Plasma Deposition Tools, 4 Lots

Описание: Tenders are sought for the supply delivery, installation and commissioning of a suite of tools in 4 Lots for silicon-based and dielectric materials for University College Cork. The new plasma tools will enhance the capabilities at the Tyndall National Institute for the fabrication of semiconductor devices, especially silicon microelectronics and silicon MEMS, but also other materials such as germanium and silicon carbide. We invite proposals for the following lots; Lot 1 Plasma Etcher Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of etching for polysilicon poly-Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 2 Plasma Etcher Metals Piezoelectrics, advanced plasma etching system capable of etching for aluminium Al and alloys molybdenum Mo aluminium scandium nitride AlScN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 3 Plasma Etcher Slow and Controllable Rate Atomic Layer Etch for Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of both conventional high-rate etching and slow and controllable rate atomic layer etching for silicon Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 4 Plasma Deposition PECVD, advanced plasma enhanced chemical vapour deposition system capable of depositing dielectric SiO₂, SiN and amorphous a-Si thin films on semiconductor substrates. This equipment will be essential for etching and depositing a range of materials used in the fabrication of silicon microelectronics, silicon photonics and silicon MEMS devices. The ideal tools will offer precision, reliability, and efficiency to meet the requirements for etching and deposition on both 100 mm and 200 mm diameter wafers. Tenderers with cutting-edge solutions that can achieve these high standards are encouraged to submit their proposals for this vital component in our technological advancement.

Идентификатор на процедурата: a024c275-b92f-48d9-83b8-52aa370660c8

Вид процедура: Открита

Процедурата се ускорява: не

2.1.1. Цел

Естество на поръчката: Доставки

Основна класификация (cprv): 38000000 Лабораторно, оптично и прецизно оборудване (без стъклени изделия)

2.1.2. Място на изпълнение

Административно-териториална единица на държавата (NUTS): South-East (IE052)
Държава: Ирландия

2.1.3. Стойност

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС: 3 300 000,00 EUR

2.1.4. Обща информация

Правно основание:

Директива 2014/24/EC

2.1.5. Условия за възлагане на обществена поръчка

Условия за подаване:

Максимален брой обособени позиции, за които един oferent може да подаде offerти: 4

2.1.6. Основания за изключване

Източници на основанията за изключване: Документ за обществени поръчки

5. Обособена позиция

5.1. Обособена позиция: LOT-0001

Заглавие: Plasma Etcher ,Silicon ,Dielectrics

Описание: Tenders are sought for the supply delivery, installation and commissioning of a suite of tools in 4 Lots for silicon-based and dielectric materials for University College Cork. The new plasma tools will enhance the capabilities at the Tyndall National Institute for the fabrication of semiconductor devices, especially silicon microelectronics and silicon MEMS, but also other materials such as germanium and silicon carbide. We invite proposals for the following lots; Lot 1 Plasma Etcher Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of etching for polysilicon poly-Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 2 Plasma Etcher Metals Piezoelectrics, advanced plasma etching system capable of etching for aluminium Al and alloys molybdenum Mo aluminium scandium nitride AlScN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 3 Plasma Etcher Slow and Controllable Rate Atomic Layer Etch for Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of both conventional high-rate etching and slow and controllable rate atomic layer etching for silicon Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 4 Plasma Deposition PECVD, advanced plasma enhanced chemical vapour deposition system capable of depositing dielectric SiO₂, SiN and amorphous a-Si thin films on semiconductor substrates. This equipment will be essential for etching and depositing a range of materials used in the fabrication of silicon microelectronics, silicon photonics and silicon MEMS devices. The ideal tools will offer precision, reliability, and efficiency to meet the requirements for etching and deposition on both 100 mm and 200 mm diameter wafers. Tenderers with cutting-edge solutions that can achieve these high standards are encouraged to submit their proposals for this vital component in our technological advancement.

Вътрешен идентификатор: 1

5.1.1. Цел

Естество на поръчката: Доставки

Основна класификация (срв): 38000000 Лабораторно, оптично и прецизно оборудване (без стъклени изделия)

5.1.2. Място на изпълнение

Административно-териториална единица на държавата (NUTS): South-East (IE052)
Държава: Ирландия

5.1.3. Очаквана продължителност

Срок: 48 Месеци

5.1.5. Стойност

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС: 3 300 000,00 EUR

5.1.6. Обща информация

Запазено участие:

Участието не е запазено.

Проект за възлагане на обществена поръчка, който не е финансиран със средства от ЕС
Поръчката попада в приложното поле на Споразумението за държавните поръчки (СДП)
: да

5.1.7. Стратегически обществени поръчки

Цел на стратегическите обществени поръчки: Няма стратегическа обществена поръчка

5.1.9. Критерии за подбор

Източници на критерии за избор: Документ за обществени поръчки

5.1.11. Документация за възлагане на обществена поръчка

Езици, на които документацията за обществената поръчка е официално достъпна:
английски

Езици, на които документацията за обществената поръчка (или части от нея) са
неофициално достъпни: английски

Краен срок за искане на допълнителна информация: 07/07/2026 12:00:00 (UTC+01:00)
централноевропейско време, западноевропейско лятно време

Адрес на документацията за обществената поръчка: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/listContractDocuments.do?resourceId=8424094>

5.1.12. Условия за възлагане на обществена поръчка

Условия за подаване:

Електронно подаване: Задължително

Адрес за подаване: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/viewTenders.do?resourceId=8424094>

Езици, на които могат да се подават оферти или заявления за участие: английски

Електронен каталог: Забранено

Оферентите могат да представят повече от една оферта: Разрешено

Краен срок за получаване на оферти: 24/07/2026 12:00:00 (UTC+01:00)
централноевропейско време, западноевропейско лятно време

Продължителност, през която офертата трябва да остане валидна: 180 Дни

Информация за обществената поръчка:

Дата на отваряне: 24/07/2026 12:30:00 (UTC+01:00) централноевропейско време,
западноевропейско лятно време

Място: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=8424094>

Условия на договора:

Изпълнението на договора трябва да се извършва в рамките на програми за създаване на защитени работни места: Все още не е известно

Електронно фактуриране: Задължително

Ще се използва електронно поръчване: не

Ще се използва електронно плащане: не

5.1.15. Техники

Рамково споразумение:

Няма рамково споразумение

Информация за динамичната система за покупки:

Няма динамична система за покупки

5.1.16. Допълнителна информация, медиация и преразглеждане (обжалване)

Организация, отговаряща за преразглеждането (обжалването): The High Court of Ireland

Организация, която предоставя достъп до документацията за поръчката без връзка с интернет: Education Procurement Service (EPS)

Организация, предоставяща повече информация за процедурите за преглед (обжалване) : The High Court of Ireland

Организация, която получава заявленията за участие: Education Procurement Service (EPS)

Организация, която обработва офертите: Education Procurement Service (EPS)

5.1. Обособена позиция: LOT-0002

Заглавие: Plasma Etcher ,Metals ,Piezoelectrics

Описание: Tenders are sought for the supply delivery, installation and commissioning of a suite of tools in 4 Lots for silicon-based and dielectric materials for University College Cork. The new plasma tools will enhance the capabilities at the Tyndall National Institute for the fabrication of semiconductor devices, especially silicon microelectronics and silicon MEMS, but also other materials such as germanium and silicon carbide. We invite proposals for the following lots; Lot 1 Plasma Etcher Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of etching for polysilicon poly-Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 2 Plasma Etcher Metals Piezoelectrics, advanced plasma etching system capable of etching for aluminium Al and alloys molybdenum Mo aluminium scandium nitride AlScN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 3 Plasma Etcher Slow and Controllable Rate Atomic Layer Etch for Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of both conventional high-rate etching and slow and controllable rate atomic layer etching for silicon Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 4 Plasma Deposition PECVD, advanced plasma enhanced chemical vapour deposition system capable of depositing dielectric SiO₂, SiN and amorphous a-Si thin films on semiconductor substrates. This equipment will be essential for etching and depositing a range of materials used in the fabrication of silicon microelectronics, silicon photonics and silicon MEMS devices. The ideal tools will offer precision, reliability, and efficiency to meet the requirements for etching and deposition on both 100 mm and 200 mm diameter wafers. Tenderers with cutting-edge solutions that can achieve these high standards are encouraged to submit their proposals for this vital component in our technological advancement.

Вътрешен идентификатор: 2

5.1.1. Цел

Естество на поръчката: Доставки

Основна класификация (срв): 38000000 Лабораторно, оптично и прецизно оборудване (без стъклени изделия)

5.1.2. Място на изпълнение

Административно-териториална единица на държавата (NUTS): South-East (IE052)
Държава: Ирландия

5.1.3. Очаквана продължителност

Срок: 48 Месеци

5.1.5. Стойност

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС: 3 300 000,00 EUR

5.1.6. Обща информация

Запазено участие:

Участието не е запазено.

Проект за възлагане на обществена поръчка, който не е финансиран със средства от ЕС
Поръчката попада в приложното поле на Споразумението за държавните поръчки (СДП)
: да

5.1.7. Стратегически обществени поръчки

Цел на стратегическите обществени поръчки: Няма стратегическа обществена поръчка

5.1.9. Критерии за подбор

Източници на критерии за избор: Документ за обществени поръчки

5.1.11. Документация за възлагане на обществена поръчка

Езици, на които документацията за обществената поръчка е официално достъпна:
английски

Езици, на които документацията за обществената поръчка (или части от нея) са
неофициално достъпни: английски

Краен срок за искане на допълнителна информация: 07/07/2026 12:00:00 (UTC+01:00)
централноевропейско време, западноевропейско лятно време

Адрес на документацията за обществената поръчка: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/listContractDocuments.do?resourceId=8424094>

5.1.12. Условия за възлагане на обществена поръчка

Условия за подаване:

Електронно подаване: Задължително

Адрес за подаване: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/viewTenders.do?resourceId=8424094>

Езици, на които могат да се подават оферти или заявления за участие: английски

Електронен каталог: Забранено

Оферентите могат да представят повече от една оферта: Разрешено

Краен срок за получаване на оферти: 24/07/2026 12:00:00 (UTC+01:00)
централноевропейско време, западноевропейско лятно време

Продължителност, през която офертата трябва да остане валидна: 180 Дни

Информация за обществената поръчка:

Дата на отваряне: 24/07/2026 12:30:00 (UTC+01:00) централноевропейско време,
западноевропейско лятно време

Място: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=8424094>

Условия на договора:

Изпълнението на договора трябва да се извършва в рамките на програми за създаване на защитени работни места: Все още не е известно

Електронно фактуриране: Задължително

Ще се използва електронно поръчване: не

Ще се използва електронно плащане: не

5.1.15. Техники

Рамково споразумение:

Няма рамково споразумение

Информация за динамичната система за покупки:

Няма динамична система за покупки

5.1.16. Допълнителна информация, медиация и преразглеждане (обжалване)

Организация, отговаряща за преразглеждането (обжалването): The High Court of Ireland

Организация, която предоставя достъп до документацията за поръчката без връзка с интернет: Education Procurement Service (EPS)

Организация, предоставяща повече информация за процедурите за преглед (обжалване) : The High Court of Ireland

Организация, която получава заявленията за участие: Education Procurement Service (EPS)

Организация, която обработва офертите: Education Procurement Service (EPS)

5.1. Обособена позиция: LOT-0003

Заглавие: Plasma Etcher ,Slow and Controllable Rate ,Atomic Layer Etch for Silicon , Dielectrics

Описание: Tenders are sought for the supply delivery, installation and commissioning of a suite of tools in 4 Lots for silicon-based and dielectric materials for University College Cork. The new plasma tools will enhance the capabilities at the Tyndall National Institute for the fabrication of semiconductor devices, especially silicon microelectronics and silicon MEMS, but also other materials such as germanium and silicon carbide. We invite proposals for the following lots; Lot 1 Plasma Etcher Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of etching for polysilicon poly-Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 2 Plasma Etcher Metals Piezoelectrics, advanced plasma etching system capable of etching for aluminium Al and alloys molybdenum Mo aluminium scandium nitride AlScN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 3 Plasma Etcher Slow and Controllable Rate Atomic Layer Etch for Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of both conventional high-rate etching and slow and controllable rate atomic layer etching for silicon Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 4 Plasma Deposition PECVD, advanced plasma enhanced chemical vapour deposition system capable of depositing dielectric SiO₂, SiN and amorphous a-Si thin films on semiconductor substrates. This equipment will be essential for etching and depositing a range of materials used in the fabrication of silicon microelectronics, silicon photonics and silicon MEMS devices. The ideal tools will offer precision, reliability, and efficiency to meet the requirements for etching and deposition on both 100 mm and 200 mm diameter wafers. Tenderers with cutting-edge solutions that can achieve these high standards are encouraged to submit their proposals for this vital component in our technological advancement.

Вътрешен идентификатор: 3

5.1.1. Цел

Естество на поръчката: Доставки

Основна класификация (срв): 38000000 Лабораторно, оптично и прецизно оборудване (без стъклени изделия)

5.1.2. Място на изпълнение

Административно-териториална единица на държавата (NUTS): South-East (IE052)
Държава: Ирландия

5.1.3. Очаквана продължителност

Срок: 48 Месеци

5.1.5. Стойност

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС: 3 300 000,00 EUR

5.1.6. Обща информация

Запазено участие:

Участието не е запазено.

Проект за възлагане на обществена поръчка, който не е финансиран със средства от ЕС
Поръчката попада в приложното поле на Споразумението за държавните поръчки (СДП)
: да

5.1.7. Стратегически обществени поръчки

Цел на стратегическите обществени поръчки: Няма стратегическа обществена поръчка

5.1.9. Критерии за подбор

Източници на критерии за избор: Документ за обществени поръчки

5.1.11. Документация за възлагане на обществена поръчка

Езици, на които документацията за обществената поръчка е официално достъпна:
английски

Езици, на които документацията за обществената поръчка (или части от нея) са
неофициално достъпни: английски

Краен срок за искане на допълнителна информация: 07/07/2026 12:00:00 (UTC+01:00)
централноевропейско време, западноевропейско лятно време

Адрес на документацията за обществената поръчка: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/listContractDocuments.do?resourceId=8424094>

5.1.12. Условия за възлагане на обществена поръчка

Условия за подаване:

Електронно подаване: Задължително

Адрес за подаване: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/viewTenders.do?resourceId=8424094>

Езици, на които могат да се подават оферти или заявления за участие: английски

Електронен каталог: Забранено

Оферентите могат да представят повече от една оферта: Разрешено

Краен срок за получаване на оферти: 24/07/2026 12:00:00 (UTC+01:00)
централноевропейско време, западноевропейско лятно време

Продължителност, през която офертата трябва да остане валидна: 180 Дни

Информация за обществената поръчка:

Дата на отваряне: 24/07/2026 12:30:00 (UTC+01:00) централноевропейско време,
западноевропейско лятно време

Място: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=8424094>

Условия на договора:

Изпълнението на договора трябва да се извършва в рамките на програми за създаване на защитени работни места: Все още не е известно

Електронно фактуриране: Задължително

Ще се използва електронно поръчване: не

Ще се използва електронно плащане: не

5.1.15. Техники

Рамково споразумение:

Няма рамково споразумение

Информация за динамичната система за покупки:

Няма динамична система за покупки

5.1.16. Допълнителна информация, медиация и преразглеждане (обжалване)

Организация, отговаряща за преразглеждането (обжалването): The High Court of Ireland

Организация, която предоставя достъп до документацията за поръчката без връзка с интернет: Education Procurement Service (EPS)

Организация, предоставяща повече информация за процедурите за преглед (обжалване) : The High Court of Ireland

Организация, която получава заявленията за участие: Education Procurement Service (EPS)

Организация, която обработва офертите: Education Procurement Service (EPS)

5.1. Обособена позиция: LOT-0004

Заглавие: Plasma Deposition ,PECVD

Описание: Tenders are sought for the supply delivery, installation and commissioning of a suite of tools in 4 Lots for silicon-based and dielectric materials for University College Cork. The new plasma tools will enhance the capabilities at the Tyndall National Institute for the fabrication of semiconductor devices, especially silicon microelectronics and silicon MEMS, but also other materials such as germanium and silicon carbide. We invite proposals for the following lots; Lot 1 Plasma Etcher Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of etching for polysilicon poly-Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 2 Plasma Etcher Metals Piezoelectrics, advanced plasma etching system capable of etching for aluminium Al and alloys molybdenum Mo aluminium scandium nitride AlScN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 3 Plasma Etcher Slow and Controllable Rate Atomic Layer Etch for Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of both conventional high-rate etching and slow and controllable rate atomic layer etching for silicon Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 4 Plasma Deposition PECVD, advanced plasma enhanced chemical vapour deposition system capable of depositing dielectric SiO₂, SiN and amorphous a-Si thin films on semiconductor substrates. This equipment will be essential for etching and depositing a range of materials used in the fabrication of silicon microelectronics, silicon photonics and silicon MEMS devices. The ideal tools will offer precision, reliability, and efficiency to meet the requirements for etching and deposition on both 100 mm and 200 mm diameter wafers. Tenderers with cutting-edge solutions that can achieve these high standards are encouraged to submit their proposals for this vital component in our technological advancement.

Вътрешен идентификатор: 4

5.1.1. Цел

Естество на поръчката: Доставки

Основна класификация (срв): 38000000 Лабораторно, оптично и прецизно оборудване (без стъклени изделия)

5.1.2. Място на изпълнение

Административно-териториална единица на държавата (NUTS): South-East (IE052)
Държава: Ирландия

5.1.3. Очаквана продължителност

Срок: 48 Месеци

5.1.5. Стойност

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС: 3 300 000,00 EUR

5.1.6. Обща информация

Запазено участие:

Участието не е запазено.

Проект за възлагане на обществена поръчка, който не е финансиран със средства от ЕС
Поръчката попада в приложното поле на Споразумението за държавните поръчки (СДП)
: да

5.1.7. Стратегически обществени поръчки

Цел на стратегическите обществени поръчки: Няма стратегическа обществена поръчка

5.1.9. Критерии за подбор

Източници на критерии за избор: Документ за обществени поръчки

5.1.11. Документация за възлагане на обществена поръчка

Езици, на които документацията за обществената поръчка е официално достъпна:
английски

Езици, на които документацията за обществената поръчка (или части от нея) са
неофициално достъпни: английски

Краен срок за искане на допълнителна информация: 07/07/2026 12:00:00 (UTC+01:00)
централноевропейско време, западноевропейско лятно време

Адрес на документацията за обществената поръчка: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/listContractDocuments.do?resourceId=8424094>

5.1.12. Условия за възлагане на обществена поръчка

Условия за подаване:

Електронно подаване: Задължително

Адрес за подаване: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/viewTenders.do?resourceId=8424094>

Езици, на които могат да се подават оферти или заявления за участие: английски

Електронен каталог: Забранено

Оферентите могат да представят повече от една оферта: Разрешено

Краен срок за получаване на оферти: 24/07/2026 12:00:00 (UTC+01:00)
централноевропейско време, западноевропейско лятно време

Продължителност, през която офертата трябва да остане валидна: 180 Дни

Информация за обществената поръчка:

Дата на отваряне: 24/07/2026 12:30:00 (UTC+01:00) централноевропейско време,
западноевропейско лятно време

Място: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=8424094>

Условия на договора:

Изпълнението на договора трябва да се извършва в рамките на програми за създаване на защитени работни места: Все още не е известно
Електронно фактуриране: Задължително
Ще се използва електронно поръчване: не
Ще се използва електронно плащане: не

5.1.15. Техники

Рамково споразумение:

Няма рамково споразумение

Информация за динамичната система за покупки:

Няма динамична система за покупки

5.1.16. Допълнителна информация, медиация и преразглеждане (обжалване)

Организация, отговаряща за преразглеждането (обжалването): The High Court of Ireland

Организация, която предоставя достъп до документацията за поръчката без връзка с интернет: Education Procurement Service (EPS)

Организация, предоставяща повече информация за процедурите за преглед (обжалване): The High Court of Ireland

Организация, която получава заявленията за участие: Education Procurement Service (EPS)

Организация, която обработва офертите: Education Procurement Service (EPS)

8. Организации

8.1. ORG-0001

Официално наименование: Education Procurement Service (EPS)

Регистрационен номер: IE 6609370 G

Пощенски адрес: Castletroy Limerick

Град: Limerick

Пощенски код: V94 DK53

Административно-териториална единица на държавата (NUTS): Mid-West (IE051)

Държава: Ирландия

Електронна поща: info@educationprocurementservice.ie

Телефон: 000

Интернет адрес: <https://www.educationprocurementservice.ie/>

Профил на купувача: <https://www.educationprocurementservice.ie/>

Роли на тази организация:

Купувач

Организация, която предоставя достъп до документацията за поръчката без връзка с интернет

Организация, която получава заявленията за участие

Организация, която обработва офертите

8.1. ORG-0002

Официално наименование: The High Court of Ireland

Регистрационен номер: The High Court of Ireland

Отдел: The High Court of Ireland

Пощенски адрес: Four Courts, Inns Quay, Dublin 7

Град: Dublin

Пощенски код: D07 WDX8

Административно-териториална единица на държавата (NUTS): Dublin (IE061)

Държава: Ирландия

Електронна поща: HighCourtCentralOffice@courts.ie

Телефон: +353 1 8886000

Роли на тази организация:

Организация, отговаряща за преразглеждането (обжалването)

Организация, предоставяща повече информация за процедурите за преглед (обжалване)

8.1. ORG-0003

Официално наименование: European Dynamics S.A.

Регистрационен номер: 002024901000

Отдел: European Dynamics S.A.

Град: Athens

Пощенски код: 15125

Административно-териториална единица на държавата (NUTS): Βόρειος Τομέας Αθηνών (EL301)

Държава: Гърция

Електронна поща: eproc-esender@eurodyn.com

Телефон: +30 2108094500

Роли на тази организация:

TED eSender

10. Промяна

Версия на предишното обявление, което трябва да бъде променено

:

46fee6a2-f409-4cd6-80db-618a50fcc925-01

Основна причина за промяната

:

Актуализирана информация

Информация за обявлението

Идентификатор/версия на обявлението: 7a2067c1-5ebe-49f4-b53b-0f9595ac5fa3 - 02

Вид на формуляра: Състезателна процедура

Вид обявление: Обявление за поръчка или концесия – стандартен режим

Подвид на обявлението: 16

Дата на изпращане на известието: 13/07/2026 16:03:29 (UTC+01:00)

централноевропейско време, западноевропейско лятно време

Езици, на които настоящото известие е официално достъпно: английски

Номер на публикуване на обявлението: 488696-2026

Номер на броя на ОВ S: 134/2026

Дата на публикуване: 15/07/2026